

光刻机系列

Mask Aligner

URE系列/DS系列



光电所设备

微电子所设备

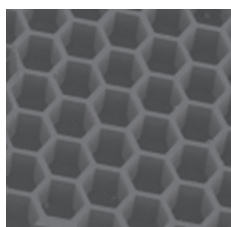
性能指标

- URE-2000 系列深度光刻机：分辨力 0.8—1 μm ，套刻精度 0.5 μm ，曝光面积 1—6 英寸，可添加纳米压印接口
- URE-2000S 双面光刻机机系列：分辨力 1 μm ，单面对准精度 0.5 μm ，双面对准精度 0.5—1 μm ，曝光面积 1—8 英寸，曝光方式底面对准或双曝光头方式，可添加纳米压印接口

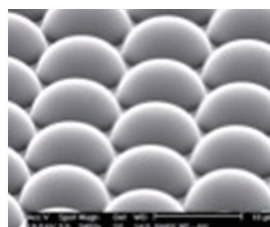
主要应用

集成电路、半导体元器件、光电子器件、光学器件的研制和生产

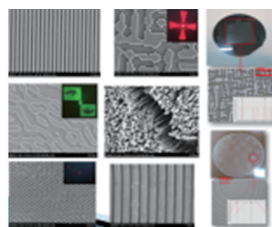
代表性应用成果



高深宽比结构



高分辨力结构



连续面形 3D 结构

主要用户单位	清华大学、北京大学、中国科技大学、复旦大学、浙江大学、上海交通大学、香港科技大学、南洋理工学院等高校，中国科学院物理研究所、西安光学精密机械研究所、微电子研究所、上海微系统与信息技术研究所、上海技术物理研究所、长春光学精密机械与物理研究所、中国电子科技集团、航天九院和四院等单位		
研制单位	中国科学院光电技术研究所、中国科学院微电子研究所		
联系方式	赵立新 028-85101784, 13568853630 zhaolixin@ioe.ac.cn	何老师 010-62049399, 13581817539 hemeng@ime.ac.cn	